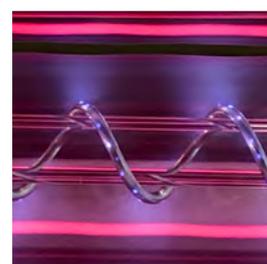
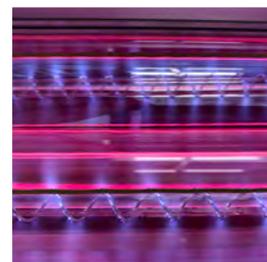


# EXCUV

엑시머 경화 시스템

다양한 응용 분야를 위한 진공 자외선



# GEW EXC 램프

GEW의 엑시머 (EXC) 램프 시스템은 유전체 장벽 방전 (DBD) 램프를 사용하여 일반적으로 172nm에서 준 단색 진공 자외선 복사를 생성합니다. 이 방사선은 일반적으로 표면 코팅의 매트 화, 접착력 향상을 위한 표면 장력 수정 또는 반도체 및 의료 산업의 표면 세척에 사용됩니다.

GEW 엑시머 램프는 12-230cm에서 생산할 수 있으며 필요한 모든 질소 비활성화 및 제어를 포함한 특정 용도에 맞게 맞춤 통합 할 수 있습니다. 겔화 또는 후 경화에 필요할 넓은 GEW UV 시스템에 원활하게 통합되어 GEW가 공정에 터키 방식의 경화 / 세정 솔루션을 제공할 수 있습니다. 당사의 숙련된 엔지니어는 국제 안전 표준을 엄격하게 준수합니다.

## 매티 파잉 (매트화)

- 온 / 오프 순간 매트
- 내구성 향상 및 공정 단순화를 위한 무첨가 코팅
- 광택 수준 > 2 G.U.
- 사전 겔화 및 최종 경화 UV 시스템에 완전히 통합

## 청소

- 다양한 반도체 기판의 고효율 세정
- 비접촉

## 표면 수정

- 표면 에너지의 현저한 증가

**열에 민감한 재료의 냉간 공정 L  
저에너지, 고효율 UV 생성 (최대 40%)**

사양	
최대 전력	5W / cm
피크 파장	172nm*
초점에서 조사	30mW / cm <sup>2</sup>
최대 길이	230cm
표준 단면	164mm W x 130mm H
냉각	N <sub>2</sub> / 공기
표준 최대 작동 온도	40°C (104°F)
표준 최대 습도	비 응축

\*222 및 308nm는 요청시 제공됩니다.



## 본사

GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, UK

UK +44 1737 824 500    Germany +49 7022 303 9769    USA +1 440 237 4439  
E sales@gewuv.com    W gewuv.com